

## عنوان مقاله:

بررسی ساختارهای Mo/Cu و Ti/Cu برای تماس اهمی در سلولهای خورشیدی مبتنی بر زیر لایه های مولتی کریستال سیلیکون

## محل انتشار:

سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (سال: 1385)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

## نویسندگان:

فاطمه دهقان نیری - آزمایشگاه تحقیقاتی لایه های نازک، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشک

بهباد اسفندیاریور - آزمایشگاه تحقیقاتی لایه های نازک، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشک

محمد رضا کتابداری - آزمایشگاه اشعه ایکس واحد اکتشاف سازمان انرژی اتمی.

شمس الدین مهاجرزاده - آزمایشگاه تحقیقاتی لایه های نازک، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشک

## خلاصه مقاله:

در این مقاله ساختارهای Mo/Cu و Ti/Cu با مقاومت تماس اهمی بسیار پایین بر روی مولتی کریستال سیلیکون لایه نشانی شده است. لایه نشانی با بیم الکترونی در شرایط خلأ بسیار بالا انجام شده و برای رسیدن به یک تماس اهمی مناسب نمونه ها در دماهای مختلف گرمادهی شده اند. تأثیر ضخامت، زمان و دمای گرمادهی روی کیفیت تماس اهمی این ساختارها بررسی شده است. مقاومت تماس حاصل برای ساختارهای Mo و Ti به ترتیب (در متن اصلی موجود می باشد) می باشد. در نهایت با مقایسه بین نتایج بدست آمده ساختار Mo/Cu به عنوان تماس اهمی مناسب برای سلولهای خورشیدی مذکور انتخاب شده است.

## کلمات کلیدی:

تماس اهمی، ساختارهای Mo/Cu و Ti/Cu، مقاومت تماس، مولتی کریستال سیلیکون.

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/52747>

